論文の内容の要旨

論文題目 Electrochemical Properties of Single-Crystal Homoepitaxial Diamond Electrodes (単結晶ダイヤモンド電極の電気化学特性)

氏 名 近藤 剛史

1. はじめに

導電性ボロンドープダイヤモンド薄膜(以下、ダイヤモンド電極)は、広い電位窓や小さい残余電流といっ た優れた電気化学特性を有しており、その応用分野も電気化学分析や電気分解を中心に近年広がりを 見せている。しかし一方で、ダイヤモンド電極の基礎特性に関してはまだ理解されていない部分が残って いる。そのひとつの原因としては、通常用いられるダイヤモンド電極は多結晶薄膜であるため、電気化学 特性に影響を与える可能性のある因子(例えば、結晶粒界、複数の結晶面、結晶性の不均一性など)が 多く混在しているためであると考えられる。本研究で取り扱う単結晶電極(Fig. 1)は、原子レベルで平坦な

単一の結晶面から成るため、このような因子が少なく、ダ イヤモンド電極の電気化学特性について、構造と機能と いう視点で詳細な評価を行うことができると考えられる。 本研究では、まず単結晶ダイヤモンド電極について基礎 的な電気化学特性を調べ、ダイヤモンド電極の大きな特 徴のひとつである表面改質による電極特性変化につい て、結晶面依存性による検討を行った。



Fig. 1 Single-Crystal Diamond Electrodes.

2. 単結晶ダイヤモンド電極の作製

本研究に用いた単結晶ダイヤモンド電極は、マイクロ波プラズマ CVD 法による、基板上へのボロンドー プダイヤモンド層のエピタキシャル成長により作製した。基板には高圧高温法による合成ダイヤモンドプレ ートを用いた。(100)および(111)を成長面として選択することにより、それぞれの結晶面についてホモエピ タキシャルボロンドープダイヤモンド薄膜を得た。合成の際の炭素源としてはアセトン・メタノール(9:1, v/v) 混合溶液を用い、メタノールに可溶な B₂O₃をホウ素源として溶解させたものを、水素ガスバブリングにより 蒸発させチャンバ内に導入した。原料のホウ素濃度は 10000 ppm B/C に調製したが、SIMS による¹¹B 濃 度測定の結果、(100)、(111)単結晶ダイヤモンド電極ではそれぞれのホウ素濃度は 2×10¹⁸、2×10¹⁹ cm⁻³と、 予想される 10²¹ cm⁻³より低い濃度であることがわかった。しかしラマンスペクトルおよび RHEED 測定の結 果、これらのサンプルは結晶性の高いエピタキシャル膜であることが確認された。

3. 単結晶ダイヤモンド電極の基礎電気化学特性

ダイヤモンド電極の最も大きな電気化学的特性である、水溶液系における広い電位窓と、電気二重層 領域における小さい残余電流について、多結晶と単結晶ダイヤモンド電極の比較を行った。両者における 0.1M H₂SO₄中の CV を比較すると、水素・酸素発生ともにほぼ同じ電位で起こり始めており、両者におい て電位窓には大きな違いがみられなかった。しかし、電 気二重層領域における残余電流は多結晶電極では約 2 μA cm⁻²であるのに比べて単結晶電極では 1 μA cm⁻²以 下と小さいことがわかった。尿酸やセロトニンといった生 体関連有機物について多結晶・単結晶ダイヤモンド電極 を用いて CV や LSV による電気化学分析を行うと、シグ ナル電流はほぼ同程度であるのに対し、バックグラウン ド電流は単結晶電極の方が小さく、その結果、バックグラ ウンド電流に対するシグナル電流の比は、多結晶電極よ り単結晶電極において大きくなった(Fig. 2)。ダイヤモンド 電極はこのような分析法において従来の電極材料よりも 検出下限の小さい高感度な電極材料であると言われて いるが、その中でも単結晶電極は特に微量な分析に適し ていることが示された。



Fig. 2 Relationship between LSV anodic peak current and uric acid concentration at polycrystalline and (100) single-crystal diamond electrodes.

4. 単結晶電極を用いたダイヤモンド酸素終端表面の電気化学特性評価

ダイヤモンド電極表面は as-grown では水素終端表面であるが、各種酸化処理により酸素終端表面に改 質することができる。このとき表面の性質は大きく変化し、水素終端表面では疎水性・表面導電性である のに対し、酸素終端表面では親水性・絶縁性となることが知られている。例えば、導電性カンチレバーを 用いた AFM により、ダイヤモンド表面に局所的に高い正電圧を印加すると、その部分だけ表面が酸化し、 周囲よりも導電性が低下することが知られている。また、ある種の酸化還元種のダイヤモンド電極におけ

る電子移動速度は、表面終端種に依存し著しく特性 が異なることも報告されている。このような表面改質 による電極特性の変化について、単結晶電極を用い た検討を行った。

多結晶および(100)、(111)単結晶ダイヤモンド電極 の、水素終端表面と陽極酸化による酸素終端表面に ついて、0.1 M H₂SO₄中における交流インピーダンス 特性を比較した。(100)電極における Bode (Phase angle vs. Frequency) プロット(Fig. 3)では、陽極酸化 後に 300-1000Hz 付近の周波数領域で容量成分を示 すピークが新たに生成していることがわかった。この 容量成分は、測定電位にほとんど依存しないことか ら、電極反応由来の成分ではないことが示唆された。 また、Mott-Schotky プロットからキャリア密度の深さ 方向分布を見積もると、表面近傍 10-30 nm の領域ま でキャリア密度が非常に少なくなっていることが示唆 され、インピーダンスのシミュレーション結果と合わせ



Fig. 3 Inpedance Bode plots for 0.1 M H2SO4 at (a) hydrogen-terminated and (b) anodically -treated (100) single-crystal diamond electrodes.

て、陽極酸化によるダイヤモンド表面の不活性層の生成が示された。ダイヤモンドの表面酸化による導電 性の低下および新たに生成した高周波数領域の容量成分は、このような不活性層の形成によるものと考 えられる。

5. 単結晶ダイヤモンドの表面化学修飾

ダイヤモンドの表面酸化では、上に述べたような電 気的特性の変化に加えて表面官能基も変化すると 考えられる。表面官能基の変化は電極表面の化学 的な性質と深く関わるものであり、また官能基の種類 は結晶面構造を反映するものであると考えられる。

(100)、(111)単結晶ダイヤモンドの陽極酸化表面に ついて、XPS による C1s のスペクトルを Fig. 4 に示す。 表面酸化によりメインピークの高エネルギー側にショ ルダーピークが観察され、酸化的な炭素原子が増加 していることがわかる。また陽極酸化表面について、 酸化的な炭素原子は(100)では2種類あり、C-O およ び C=O に由来すると考えられる。一方、(111)では C-O の1種類であり、ダイヤモンド表面に生成する表 面官能基は結晶面に依存することが示唆された。ま た、陽極酸化処理表面と酸素プラズマ処理表面にお いて、生成する表面官能基の種類が異なることも示 された。



Fig. 4 XPS C1s spectra for anodically-treated (a) (100) and (b) (111) diamond surfaces.

水素アニール処理直後の水素終端ダイヤモンド電極について、 $0.1M H_2SO_4$ 中で LSV を測定すると、酸素発生電流が流れ始める前の、+1.4-1.8 V vs. Ag/AgCl 付近に酸化ピークが見られた(Fig. 5)。このピーク ははじめの1回目のみ観察され、2回目以降は著しく減少するか観察されなかった。この酸化ピーク電位

は(100)と(111)ではピーク電位が異なり、結晶面に依存 していることが分かった。このことから、この酸化ピーク はダイヤモンド表面における水素終端から酸素終端へ の変化、すなわち酸素含有表面官能基の生成に基づく ことが推察される。実際に、酸化ピークにおける電荷量 は、表面第1層の酸化に必要な電荷量とほぼ同程度で あることがわかった。多結晶電極では、(100)および (111)で観察されたピークが両方とも観察された。

表面官能基の分析およびその利用の可能性を検討 するために、カルボニル基およびヒドロキシル基と選択 的に反応する 2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)およ び 3-aminopropyltriethoxysilane(APTES)による酸素終 端ダイヤモンドの表面化学修飾を試みた。電極表面の



Fig. 5 LSVs for 0.1 M H_2SO_4 at hydrogen -terminated polycrystalline and single-crystal diamond electrodes.

カルボニル基の存在により電子移動が促進される $Fe^{2+/3+}$ を プローブとして、CV により電子移動速度変化を調べると、 (111)電極では陽極酸化表面と DNPH 処理表面でほとんど ピーク電位差(ΔE_p)に変化が見られなかったのに対し、 (100)電極では DNPH 処理後に ΔE_p の増加、すなわち電子 移動速度の減少が見られた(Fig. 6)。これは(100)電極にの み DNPH 修飾によるカルボニル基の不活性化が起きてい ることを示しており、すなわちダイヤモンド表面の陽極酸化 ではカルボニル基は(100)に選択的に生成することを示唆 している。逆に、APTES 処理による $Fe(CN)_6^{3-/4}$ の電子移動 速度変化は(100)電極より(111)電極において大きく、すな わち(111)ダイヤモンドの陽極酸化表面ではヒドロキシル基 が多く存在していることが示唆された。



Fig. 6 CV peak separation (ΔE_p) for Fe^{2+/3+} at hydrogen-terminated, anodically-treated and DNPH-modified single-crystal diamond electrodes.

6. <u>まとめ</u>

①ダイヤモンド電極に特徴的な広い電位窓、小さい残余電流、速い電子移動などの特性はいずれも単結 晶電極で観察される現象であり、ダイヤモンド表面自身の特性に基づくものであるといえる。特に単結晶 電極では多結晶電極よりも電気二重層領域における残余電流が小さく、電気化学法による微量分析に応 用できる可能性がある。

②ダイヤモンドの表面酸化では、表面近傍のキャリア密度減少による不活性層の形成、および酸素含有 表面官能基の生成という2つの変化が起きていることが、XPS、交流インピーダンス測定、表面化学修飾 などの結果から導かれた。特にダイヤモンド表面に生成する官能基の種類はダイヤモンド表面の結晶面 構造を反映しており、単結晶電極を用いた評価がダイヤモンド電極の電気化学特性の理解に有用である ことが示された。